

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84110285.8

⑤ Int. Cl.⁴: C 08 F 2/50, G 03 C 1/68

② Anmeldetag: 29.08.84

③ Priorität: 01.09.83 DE 3331474

⑦ Anmelder: BASF Aktiengesellschaft,
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 05.08.85
Patentblatt 85/23

72 Erfinder: Holoch, Klaus, Dr., Virchowstrasse 4,
D-6712 Bobenheim-Roxheim (DE)
Erfinder: Henne, Andreas, Dr.,
Adolf-Kolping-Strasse 137 a, D-6730 Neustadt (DE)
Erfinder: Lechtich, Peter, Dr., Ludwigshafener
Strasse 6 b, D-6710 Frankenthal (DE)

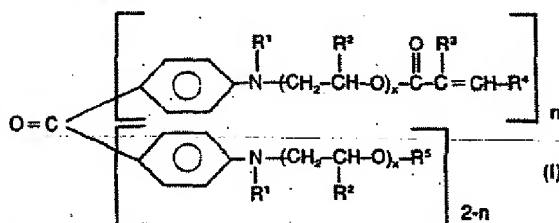
ⓑ Benannte Vertragsstaaten: **BE CH DE FR GB IT LI**

⑤4 Photopolymerisierbare Mischungen mit speziellen Diaminobenzophenon-Verbindungen.

57) Photopolymerisierbare Mischungen mit einer photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindung sowie gegebenenfalls einem polymeren Bindemittel, enthalten als Photosensibilisator eine Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I)

$x = 1, 2$ oder 3 ,
 $n = 0, 1$ bis 2
bedeuten.

Die Verbindungen der Formel (I) lassen sich z.B. durch Umsetzung von Bis(N-hydroxyethyl-amino)-benzophenonen mit Maleinsäureanhydrid oder Acryl- oder Methacrylsäurechlorid herstellen. Die Mischungen sind auch bei höheren Photosensibilisator-Konzentrationen gut verträglich und ohne Auskristallisation bei Raumtemperatur lange Zeit lagerfähig. Sie eignen sich besonders für pigmenthaltige UV-härtende Druckfarben, für Photoresiste und für maskenbildende Schichten, Kopierfilme und mehrschichtige Aufzeichnungsmaterialien:



world

$R^1 = H, C_1\text{- bis } C_4\text{-Alkyl oder Phenyl.}$

$R^2 = H$ oder C_1 - bis C_3 -Alkyl,

$R^3 = H$ oder C_1 - bis C_4 -Alkyl,

$C^4 = H, C_1\text{- bis } C_4\text{-Alkyl, } -CO_2R^7 \text{ oder } -CONHR^8,$

$R^5 = H, -COR^6$ oder $-CONHR^6$.

$R^4 = C_1$ - bis C_8 -Alkyl oder Phenyl,

$$R^7 = H \text{ oder } R^6,$$

R⁹ = aliphatischer oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 C-Atomen.

Photopolymerisierbare Mischungen mit speziellen Diaminobenzophenon-Verbindungen

Die Erfindung betrifft photopolymerisierbare Mischungen mit mindestens
05 einer photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindung sowie gegebenenfalls einem polymeren Bindemittel, die spezielle Diaminobenzophenon-Verbindungen als Sensibilisator enthalten sowie die Verwendung solcher Mischungen für maskenbildende Schichten, für Kopierfilme und mehrschichtige Aufzeichnungsmaterialien.

10

Photopolymerisierbare Mischungen mit olefinisch ungesättigten Verbindungen, gegebenenfalls polymeren Bindemitteln und Photoinitiatorsystemen, die Diaminobenzophenon-Verbindungen als Sensibilisatoren enthalten, sind bekannt. So ist das synergistische System aus 4,4'-Bis(dimethylamino)-benzophenon (Michlers Keton) und Benzophenon aufgrund seiner hohen Lichtabsorption, Radikalbildungsrate und seines neutralen Verhaltens auf die
15 Dunkellagerstabilität ein sehr wirksames Photoinitiatorsystem besonders für dünne photopolymerisierbare Schichten. Dabei wirkt das hochabsorbierende Michlers Keton als Sensibilisator für das im gleichen aktinischen

20 Wellenbereich wenig oder niedrig lichtabsorbierende Benzophenon. Besonders bei der Herstellung von Kopier- und Maskenfilmen ist die Verwendung von Photoinitiatorsystemen in recht hohen Konzentrationen, z.B. von Michlers Keton in einer Konzentration von über 6 Gew.% gewünscht, um die gehärteten Maskenfilmteile bei einer anschließenden Belichtung UV-polymersierender Schichten unter dem Maskenfilm für UV-Licht undurchlässig zu
25 machen.

Die Verwendung von höheren Konzentrationen von Michlers Keton in Photoinitiatorsystemen in dünnen photopolymerisierbaren Schichten führt jedoch

30 häufig zu Schwierigkeiten, da Michlers Keton in seinen toxischen Eigenschaften, wegen seiner begrenzten Löslichkeit in vielen organischen Lösungsmitteln und seiner begrenzten Verträglichkeit selbst mit manchen polaren Bindemitteln für photopolymerisierbare Mischungen nicht befriedigt. So kommt es z.B. bei höheren Konzentrationen an Michlers Keton
35 in photopolymerisierbaren Mischungen zur Trübung gelagerter Schichten, während Benzophenon problemlos auch in größerer Konzentration verarbeitet werden kann.

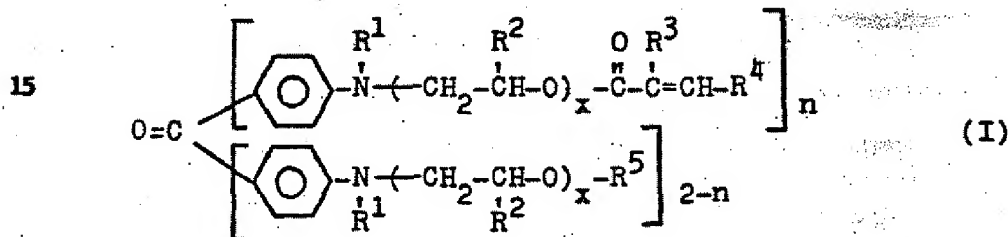
Aus der DE-OS 27 30 897 ist bekannt, Derivate von Michlers Keton zu verwenden, bei denen die Methylgruppen in Michlers Keton z.B. durch Hydroxyethyl-, Hydroxyethoxyethyl-, Hydroxypropyl- oder Hydroxypropoxypropyl-
40 -Gruppen ersetzt sind. Diese Verbindungen weisen zwar bereits eine verbesserte Verträglichkeit auf, befriedigen jedoch noch nicht in allen Fällen.

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, Diaminobenzophenon-Verbindungen als Photosensibilisatoren für photopolymerisierbare Mischungen zu finden, die bei guter Wirkung als Photosensibilisator eine verbesserte Verträglichkeit bei längerer Lagerung aufweisen.

05

Es wurde nun gefunden, daß photopolymerisierbare Mischungen auf der Basis mindestens einer photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindung sowie gegebenenfalls einem polymeren Bindemittel enthaltend mindestens eine Diaminobenzophenon-Verbindung als Photosensibilisator die ge-

10 wünschten Eigenschaften aufweisen, wenn sie eine Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I)



20

enthalten, worin

R^1 = H, C_1 - bis C_4 -Alkyl oder Phenyl,

R^2 = H oder C_1 - bis C_2 -Alkyl,

25 R^3 = H oder C_1 - bis C_4 -Alkyl, vorzugsweise H oder Methyl,

R^4 = H, C_1 - bis C_4 -Alkyl, $-\text{CO}_2\text{R}^7$ oder $-\text{CONHR}^8$,

R^5 = H, $-\text{COR}^6$ oder $-\text{CONHR}^8$,

R^6 = C_1 - bis C_8 -Alkyl oder Phenyl,

R^7 = H oder R^6 ,

30 R^8 = aliphatischer oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 C-Atomen,

x = 1, 2 oder 3,

n = 0, 1 bis 2

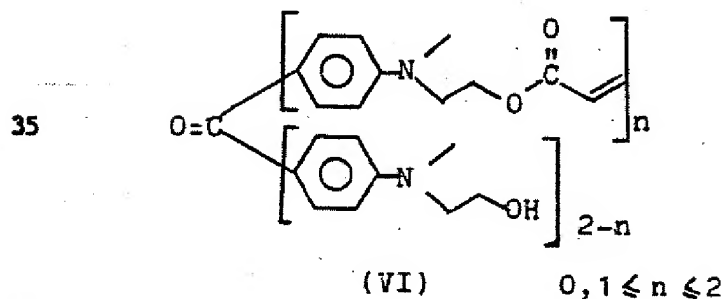
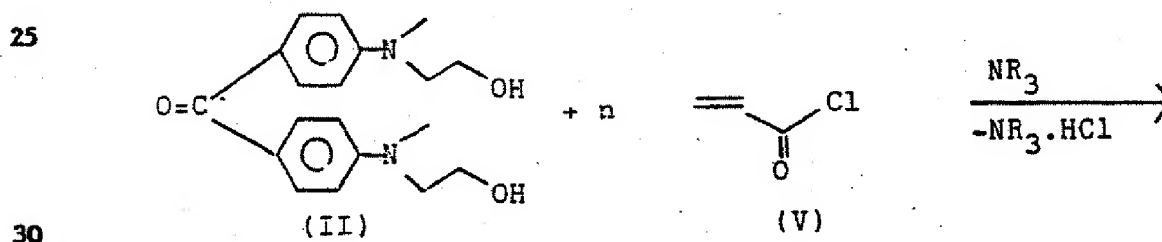
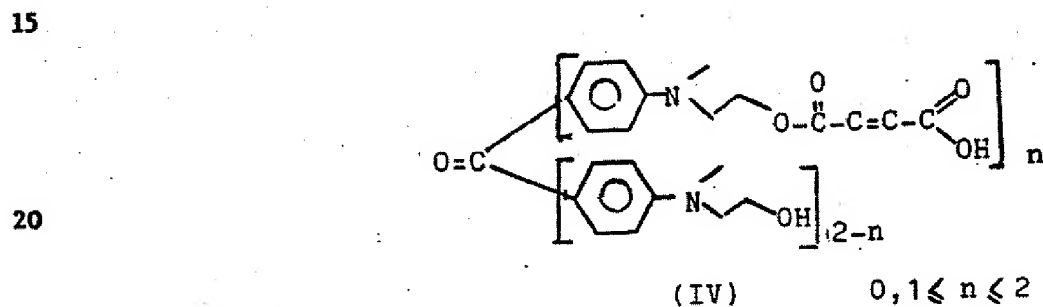
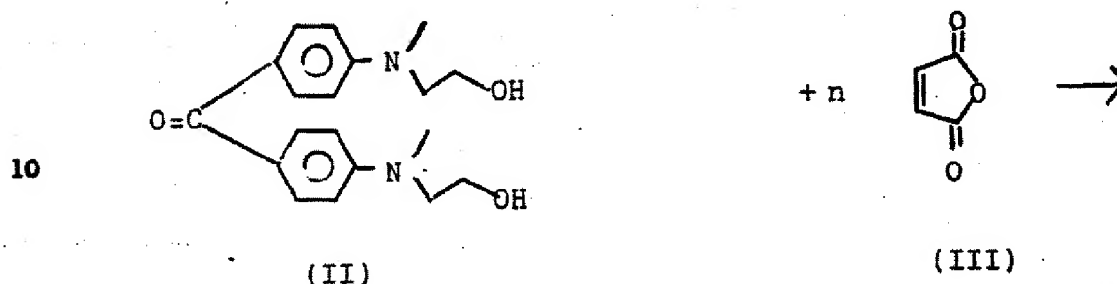
bedeuten.

35 Die erfindungsgemäß verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindungen der Formel (I) stellen Reaktionsprodukte von alkoxylierten Diaminbenzophenonen mit α, β -olefinisch ungesättigten Carbonsäuren, insbesondere Maleinsäure, Acryl- oder Methacrylsäure, oder ihren Derivaten dar, die gegebenenfalls auch mit Alkanolen, Carbonsäuren und/oder Isocyanaten verestert

40 bzw. zum Amid umgesetzt wurden. Bevorzugt sind es Umsetzungsprodukte von Bis-(N-hydroxyethylamino)benzophenonen mit Maleinsäureanhydrid oder den Anhydriden oder Chloriden der Acryl- oder Methacrylsäure, wobei die N-Hydroxyalkylgruppen teilweise oder ganz verestert werden, wobei noch

eine Umsetzung freier Hydroxylgruppen, freier Carboxylgruppen mit Alkoholen, Carbonsäuren oder deren Derivaten oder Isocyanaten erfolgen kann.

Die folgenden Gleichungen geben bevorzugte Beispiele für die Veresterung
05 wieder:



II: 4,4'-Bis(N-methyl-N- β -hydroxyethyl-amino)-benzophenon
(beschrieben in DE-OS 27 22 421)

III: Maleinsäureanhydrid

V: Acrylsäurechlorid

05

Die freie Carboxylgruppe der Verbindung der Formel (IV) sowie die freien Hydroxylgruppen der Verbindungen der Formeln (IV) oder (VI) lassen sich auch z.B. verestern oder mit Isocyanaten zu Amiden bzw. Urethanen umsetzen.

10 Von den Umsetzungsprodukten der vorstehenden Art haben sich die Kondensationsprodukte von 1,1 bis 1,4 und insbesondere etwa 1,3 Molen Maleinsäureanhydrid mit 1 Mol Bis(N-alkyl-N- β -hydroxyethylamino)-benzophenon, die bei ca. 110 bis 140°C bevorzugt in Abwesenheit von Lösungsmittel umgesetzt wurden, besonders bewährt.

15

Die erfindungsgemäß verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindungen erlauben aufgrund ihrer guten Verträglichkeit mit üblichen photopolymerisierbaren Mischungen einen Einsatz auch in höheren Konzentrationen, z.B. 10 bis 15 Gew.%, bezogen auf den Feststoffgehalt der Mischungen, ohne daß selbst

20 bei wochenlanger, ja monatelanger Lagerung bei Raumtemperatur eine Ausscheidung bzw. ein Auskristallisieren der Diaminobenzophenon-Verbindung erfolgt.

Von besonderem Vorteil ist es, in den erfindungsgemäßen Mischungen neben
25 den Diaminobenzophenon-Verbindungen einen weiteren bekannten Photoaktivator mitzuverwenden, wie Benzoin, Benzoinether, Anthrachinon, Benzil, Benzilmonoalkylketale, Fluoren, Fluoren, Diacetyl und insbesondere Benzophenon oder ein im Bereich von 300 bis 380 nm niedrig absorbierendes Benzophenonderivat, wie solchen mit einem Extinktionskoeffizienten

30 $\epsilon_{360 \text{ nm}} < 200$, wobei die für die Kombination mit Michlers Keton bekannten molaren Verhältnisse und Mengen angewandt werden können.

Die erfindungsgemäß verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindungen verbessern überraschenderweise auch die Verträglichkeit von Michlers Keton, so
35 daß es sich zur Erzielung einer hohen optischen Dichte bei gleichzeitig hoher Lichtempfindlichkeiten bei Maskenfilmen als recht vorteilhaft erwiesen hat, als Photoinitiator-System eine Kombination einer erfindungsgemäß verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I) mit insbesondere etwa 20 bis 50 Gew.% an Michlers Keton, bezogen auf die Menge der Diamino-
40 phenon-Verbindung der Formel (I) und bevorzugt mit etwa 1/3 bis 2/3 der Summe der Mengen an Michlers Keton und Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I) an Benzophenon zu verwenden.

- Die erfindungsgemäßen photopolymerisierbaren Mischungen enthalten in bekannter Weise photopolymerisierbare olefinisch ungesättigte Verbindungen wie Monomere und/oder Oligomere, die zumindest teilweise mehrfach olefinisch ungesättigt sind und in Gegenwart von Photoinitiator-Systemen sich rasch durch UV-Bestrahlung in in Entwicklern schwer- oder unlösliche Produkte überführen lassen. Dabei eignen sich die photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindungen, die für mit UV-Licht vernetzbare Bindemittel und für Photopolymer-Druckplatten an sich bekannt sind, wobei sich Art und Menge nach dem Anwendungszweck der Mischungen richtet sowie nach dem gegebenenfalls mitverwendeten polymeren Bindemittel, mit dem sie verträglich sein sollen.

- Geeignete olefinisch ungesättigte Verbindungen sind Di- und Polyacrylate und -methacrylate, wie sie durch Veresterung von Diolen oder Polyolen mit Acrylsäure oder Methacrylsäure hergestellt werden können, wie die Di- und Tri(meth)acrylate von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht bis etwa 500, 1,2-Propan-diol, 1,3-Propandiol, Neopentylglykol (2,2-Dimethylpropandiol), 1,4-Butan-diol, 1,1,1-Trimethylolpropan, Glycerin oder Pentaerythrit; ferner die Monoacrylate und Monomethacrylate solcher Diole und Polyole, wie z.B. Ethylenglykol- oder Di-, Tri- oder Tetraethylenglykol-monoacrylat, Monomere mit zwei- oder mehr olefinisch ungesättigten Bindungen, die Urethan-gruppen und/oder Amidgruppen enthalten, wie die aus aliphatischen Diolen der vorstehend genannten Art, organischen Diisocyanaten und Hydroxy-alkyl(meth)acrylaten hergestellten niedermolekularen Verbindungen. Genannt seien auch Acrylsäure, Methacrylsäure sowie deren Derivate wie (Meth)acrylamid, N-Hydroxymethyl(meth)acrylamid oder (Meth)acrylate von Monoalkoholen mit 1 bis 6-C-Atomen.

- Sehr bewährt haben sich erfindungsgemäße Mischungen, die polare Monomere und/oder polare polymere Bindemittel enthalten, wie Urethanacrylate oder Expoxidacrylate. Bezüglich geeigneter Bindemittelkomponenten sowie der Anwendung der erfindungsgemäßen Systeme sei auf die DT-OS 15 22 359, 22 00 478, 23 58 948, 24 41 148 verwiesen, wobei die erfindungsgemäß verwendeten Diaminobenzophenon-Verbindungen an die Stelle des dort beschriebenen Michlers Keton treten können.

- Geeignete polymere Bindemittelkomponenten sind z.B. Polyurethane, ungesättigte Polyester, Polyesterurethane sowie carboxylgruppenhaltige Polymere wie Copolymere von Acrylsäure, Methacrylsäure und insbesondere Maleinsäure oder deren Derivaten.

In bekannter Weise können die erfindungsgemäßen photopolymerisierbaren Mischungen auch übliche Zusätze enthalten, wie thermische Polymerisationsinhibitoren, Farbstoffe, Weichmacher usw.

- 05 Besondere Bedeutung kommt der größeren Löslichkeit der erfindungsgemäß angewendeten Diaminobenzophenone bei ihrer Verwendung für eine ausreichende Härtung hoch pigmentierter photopolymerisierbarer Systeme zu, insbesondere bei Verwendung hochabsorbierender Pigmente, z.B. in UV-härtenden Druckfarben.

10

Die erfindungsgemäßen photopolymerisierbaren Mischungen eignen sich besonders in Schichtdicken kleiner als 10 µm für UV-härtende Druckfarben, aber auch für Offsetdruckplattenbeschichtungen und als Photoresist-Material.

- Besonders bewährt haben sie sich für maskenbildende Schichten, für Kopier-
15 filme und mehrschichtige Aufzeichnungsmaterialien. So ist es möglich, auf übliche UV-vernetzbare Photopolymerdruckplatten einen hochempfindlichen Maskenfilm mit hohem Photosensibilisator- und -initiatorgehalt mit einer dünnen Polymerfolie als Träger aufzukaschieren, der bildmäßig durch eine Vorlage oder mit UV-Laser mit einer Belichtungszeit von wenigen Sekunden
20 belichtet werden kann, ohne daß dabei eine Photovernetzung der darunter befindlichen photovernetzbaren reliefbildenden Schicht der Photopolymerdruckplatte eintritt. Nach Entwicklung des Maskenfilms mit z.B. wäßrigem Alkali kann dann durch die erzeugte Maskenschicht die Photopolymerdruckplatte vollflächig mit UV-Strahlung belichtet und nach Abziehen des Mas-
25 kenfilms in üblicher Weise zur Reliefform bzw. Reliefdruckform entwickelt werden. Zweckmäßig tragen die Kopierfilme bzw. aufkaschierbaren Maskenfilme über der photopolymerisierbaren Schicht auf der transparenten Trägerfolie einen vor der Belichtung abziehbaren Deckfilm wie einen mit z.B. einem Polyamidsubstrat versehenen Polyesterfilm.

30

Die in den nachstehenden Beispielen genannten Teile und Prozente beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Gewicht. Volumenteile verhalten sich zu Gewichtsteilen wie Liter zu Kilogramm.

35 Beispiel 1

1.1 Herstellung eines Reaktionsproduktes aus 4,4'-Bis(N-methyl-N-β-hydroxyethylamino)-benzophenon und Maleinsäureanhydrid

- 40 164 Teile 4,4'-Bis(N-methyl-N-β-hydroxyethylamino)-benzophenon und 63,7 Teile Maleinsäureanhydrid werden in einem Reaktionsgefäß gemischt und in Abwesenheit von Lösungsmittel 10 Minuten bei 130°C ge-

rührt. Das viskose Reaktionsprodukt wird auf eine Aluminiumfolie gegossen und die glasartig harte Masse nach dem Erstarren zerkleinert.

Analyse:

05 ber. (für $C_{24,2}H_{26,6}N_2O_{6,9}$) C: 63,7 % H: 5,8 % N: 6,1 %
gef. C: 62,9 % H: 5,9 % N: 6,0 %

1.2 Herstellung einer maskenbildenden Schicht

10 Auf eine durch Corona-Entladung vorbehandelte 125 μ m starke Polyethy-
lenterephthalatfolie, die zuerst mit einer 2 bis 3 μ m starken Poly-
amid-Substratschicht, dann mit einer 10 μ m starken Schicht eines Poly-
vinylalkohols (Verseifungsgrad 88 Mol%, Viskosität 18 cP) versehen
15 wurde, wird eine gefilterte Lösung von 180 Teilen eines Copolymeri-
sates aus 40 % n-Butylacrylat, 35 % Styrol und 25 % Methacrylsäure,
120 Teilen 1,1,1-Trimethylolpropan-triacrylat, 48 Teilen des gemäß
1.1 hergestellten Reaktionsproduktes, 12 Teilen Michlers Keton,
30 Teilen Benzophenon, 6,3 Teilen eines Nitrosamins in 900 Teilen
Methylethylketon, der 50 Teile einer gesättigten Lösung des Farb-
20 stoffs 3-Amino-5-nitro-2,1-benzisothiazol \rightarrow N-(2-Methoxycarbonyl-
ethyl)-N-ethylanilin in Methylethylketon zugesetzt wurden, so schicht-
förmig aufgegossen, daß eine 6 μ m starke Schicht nach dem Trocknen
entsteht. Auf diese wird eine 12 μ m starke transparente Polyethylen-
terephthalatfolie aufkaschiert. Die photopolymerisierbare Schicht
25 kann monatelang bei Raumtemperatur gelagert werden, ohne daß eine
Auskristallisation des Photosensibilisators auftritt.

1.3 Verwendung der maskenbildenden Schicht bei der Herstellung einer
Reliefdruckplatte

30 Die gemäß 1.2 hergestellte maskenbildende Schicht wird mit der 12 μ m
starke Polyesterfolie nach unten auf eine handelsübliche Hochdruck-
photopolymerplatte, die durch Bestrahlen mit UV-Licht photovernetzt
werden kann, aufkaschiert. Zur Herstellung des Druckklischees wird
35 die 125 μ m starke Polyesterfolie mit dem Polyamidsubstrat abgezogen
und die photopolymerisierbare Mischung des Maskenfilms bildmäßig etwa
3 Sekunden lang belichtet. Nach Abwaschen der Polyvinylalkoholschicht
werden die unbelichteten Anteile der photopolymerisierbaren Schicht
des Maskenfilms mit wäßrigem Alkali (pH = 11) ausgewaschen, und danach
40 wird durch den resultierenden Maskenfilm die Hochdruckphotopolymer-
platte 3 bis 5 Minuten vollflächig belichtet. Nach dem anschließenden
Abziehen der Maske kann die Hochdruckphotopolymerplatte in üblicher
Art entwickelt und zur Reliefdruckform weiterverarbeitet werden.

Beispiel 2

2.1 Herstellung eines Reaktionsproduktes aus 4,4'-Bis(N-methyl-N-β-hydroxyethylamino)-benzophenon und Acrylsäurechlorid

05

130,4 Teile 4,4'-Bis(N-methyl-N-β-hydroxyethylamino)-benzophenon, 0,2 Teile Hydrochinon und 91 Teile Triethylamin werden in einem Reaktionsgefäß in 300 Volumenteilen Dimethylformamid gelöst. In die auf 0 bis 5°C gekühlte Lösung werden unter Rühren langsam portionsweise

10

58 Teile Acrylsäurechlorid zugegeben und dann 15 Stunden bei 25°C nachgerührt. Nach Zugabe von 800 Volumenteilen Methylenchlorid wird die Lösung in 1000 Volumenteile Wasser eingebracht, die untere Phase abgetrennt und noch zweimal mit je 500 Volumenteilen Wasser ge-

15

waschen. Dann wird mit 600 Volumenteilen 5 %iger wässriger Natriumcarbonatlösung gewaschen. Nach Zusatz von 0,2 Teilen Hydrochinon wird das Lösungsmittel im Wasserstrahlvakuum abgezogen und der Rückstand im Vakuum von 0,1 Torr bei 30°C getrocknet. Es verbleiben 115,6 Teile eines zähflüssigen Reaktionsproduktes, das nach der NMR-Analyse die Verbindung der Formel (VI) mit n etwa 1,2 darstellt.

20

NMR-Analyse (Lösungsmittel CDCl₃): Signale bei 3,06 ppm (100 %); 3,57 ppm (breit, 22,6 %); 3,62 ppm (breit, 48 %); 3,8 ppm (breit, 22,6 %); 4,37 ppm (breit, 48 %); 5,84 (Dublett, 19,4 %); 6,10 ppm (Multipllett, 19,4 %); 6,38 ppm (Dublett, 19,4 %); 6,65 bis 6,8 ppm (Multipllett, 74,2 %); 7,6 bis 7,8 ppm (Multipllett, 74,2 %).

25

2.2 Herstellung einer maskenbildenden Schicht

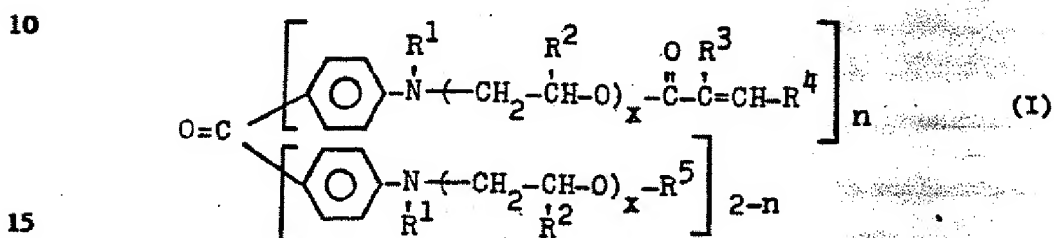
30

Es wird wie in Beispiel 1.2 verfahren, jedoch werden anstelle von 48 Teilen des gemäß 1.1 hergestellten Reaktionsproduktes und 12 Teilen Michlers Keton 40 Teile des gemäß 2.1 hergestellten Reaktionsproduktes verwendet. Die resultierenden Schichten sind ohne Auskristallisation viele Wochen bei Raumtemperatur lagerfähig.

35

Patentansprüche

1. Photopolymerisierbare Mischung auf der Basis mindestens einer photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindung sowie gegebenenfalls eines polymeren Bindemittels, enthaltend mindestens eine Diaminobenzophenon-Verbindung als Photosensibilisator, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I)



enthält, worin bedeuten:

- 20 $\text{R}^1 = \text{H}, \text{C}_1\text{-bis C}_4\text{-Alkyl oder Phenyl},$
 $\text{R}^2 = \text{H oder C}_1\text{-bis C}_2\text{-Alkyl},$
 $\text{R}^3 = \text{H oder C}_1\text{-bis C}_4\text{-Alkyl},$
 $\text{R}^4 = \text{H}, \text{C}_1\text{-bis C}_4\text{-Alkyl}, -\text{CO}_2\text{R}^7 \text{ oder } -\text{CONHR}^8,$
 $\text{R}^5 = \text{H}, -\text{COR}^6 \text{ oder } -\text{CONHR}^8,$
 25 $\text{R}^6 = \text{C}_1\text{-bis C}_8\text{-Alkyl oder Phenyl},$
 $\text{R}^7 = \text{H oder R}^6,$
 $\text{R}^8 = \text{aliphatischer oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 C-Atomen},$
 $x = 1, 2 \text{ oder } 3,$
 $n = 0, 1 \text{ bis } 2.$
 30 2. Photopolymerisierbare Mischung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I) enthält, worin
 $\text{R}^3 = \text{H oder Methyl},$
 35 $\text{R}^4 = \text{H oder } -\text{CO}_2\text{R}^7 \text{ und}$
 $\text{R}^5 = \text{H bedeuten.}$
 3. Photopolymerisierbare Mischung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich zur Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I) Michlers Keton enthält.

4. Photopolymerisierbare Mischung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich zu den Diaminobenzophenon-Verbindungen der Formel (I) Benzophenon oder ein im Bereich von 300 bis 380 nm niedrig absorbierendes Benzophenonderivat enthält.

05

5. Verwendung von photopolymerisierbaren Mischungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 für maskenbildende Schichten, für Kopierfilme und mehrschichtige Aufzeichnungsmaterialien.

10



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 143 201
A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 84110285.8

Int. Cl.: C 08 F 2/50, G 03 C 1/68

Anmeldetag: 29.08.84

Priorität: 01.09.83 DE 3331474

Anmelder: BASF Aktiengesellschaft,
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 05.06.85
Patentblatt 85/23

Benannte Vertragsstaaten: BE CH DE FR GB IT LI

Erfinder: Holoch, Klaus, Dr., Virchowstrasse 4,
D-6712 Bobenheim-Roxheim (DE)
Erfinder: Henne, Andreas, Dr.,
Adolf-Kolping-Strasse 137 a, D-6730 Neustadt (DE)
Erfinder: Lechtken, Peter, Dr., Ludwigshafener
Strasse 6 b, D-6710 Frankenthal (DE)

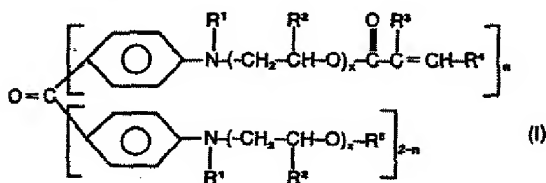
Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 28.08.85 Patentblatt 85/35

Photopolymerisierbare Mischungen mit speziellen Diaminobenzophenon-Verbindungen.

Photopolymerisierbare Mischungen mit einer photopolymerisierbaren olefinisch ungesättigten Verbindung sowie gegebenenfalls einem polymeren Bindemittel, enthalten als Photosensibilisator eine Diaminobenzophenon-Verbindung der Formel (I)

X = 1, 2 oder 3,
n = 0, 1 bis 2
bedeuten.

Die Verbindungen der Formel (I) lassen sich z.B. durch Umsetzung von Bis(N-hydroxyethyl-amino)-benzophenonen mit Maleinsäureanhydrid oder Acryl- oder Methacrylsäurechlorid herstellen. Die Mischungen sind auch bei höheren Photosensibilisator-Konzentrationen gut verträglich und ohne Auskristallisation bei Raumtemperatur lange Zeit lagerfähig. Sie eignen sich besonders für pigmenthaltige UV-härtende Druckfarben, für Photoresiste und für maskenbildende Schichten, Kopierfilme und mehrschichtige Aufzeichnungsmaterialien.



worin

- R¹ = H, C₁- bis C₆-Alkyl oder Phenyl,
- R² = H oder C₁- bis C₂-Alkyl,
- R³ = H oder C₁- bis C₆-Alkyl,
- C⁴ = H, C₁- bis C₆-Alkyl, -CO₂R⁷ oder -CONHR⁸,
- R⁵ = H, -COR⁶ oder -CONHR⁸,
- R⁶ = C₁- bis C₆-Alkyl oder Phenyl,
- R⁷ = H oder R⁶,
- R⁸ = aliphatischer oder aromatischer Rest mit 2 bis 22 C-Atomen,

EP 0 143 201 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0143201
Nummer der Anmeldung

EP 84 11 0285

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
D, A	DE-A-2 730 897 (BASF) -----		C 08 F 2/50 G 03 C 1/68
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 08 F G 03 C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29-04-1985	Prüfer CAUWENBERG C. L. M.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			